ZDP-300 振动抛光机

振动抛光机 • 产品技术资料

资料编号: MC-DS-ZDP-300-ZH • 生成日期: 2026-11-14



振动抛光可去除样品表面机械化制样后残留的细微变形层，消除样品的表面应力，提高样品表面光洁度。对于电子背散射衍射(EBSD) 分析、原子力显微镜（AFM）分析、电镜（SEM）分析等，前序样品制备非常有效。 同时，振动抛光因其优异的机械 - 化学抛光效果，适合大部分材料的精抛和终抛，尤其适用于软质和韧性材料，如纯钛及钛合金、纯铝及铝合金、纯铜及铜合金、镍基合金、高温合金等。

技术参数

型号	ZDP-300
机体形式	台式
控制方式	触摸屏控制
抛盘尺寸	305 mm
抛光直径	Φ8-50 mm（特殊尺寸可定制）
主机功率	1.5 KW
频率调节	自动（0-400Hz 可调）
电压调节	自动（0-220V 可调）
电源	220V
外形尺寸	500*480*320 mm（长 * 宽 * 高）
净重	59.5 KG
毛重	70 KG
基本配置	
主机	一台
透明防尘盖	主机上
夹持器	Φ25/30/40 mm 三规格各 3 套，可夹镶嵌或裸样
抛光耗材	终抛布 1 张、0.05 μm 氧化铝粉 1 瓶、0.02 μm 二氧化硅悬浮液 1 瓶
配重块	两块
水平泡	一个

电源线	一根
技术资料	一份（说明书、合格证、保修卡）

联系方式

电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850

邮箱: shanghai@yr17.net

地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号

网站: www.cnnoet.com

本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。

© 2026 MICROCRE